

第26回電子顕微鏡解析技術フォーラム

会議録

(1) 日時：2006年10月16～17日

(2) 場所：ピアザ淡海（滋賀県）

(3) テーマ：電子顕微鏡解析技術フォーラム

(4) 成果：最近、産業界で応用が広がっているSTEMについて基礎から実用まで講演を行った。きれいなSTEM像を得るKeyともなる試料作製について、FIBによるダメージ層の除去に焦点をあて新技法の紹介や比較検討を行った。さらに電圧印加型のその場TEM観察やFIB内での加熱実験を紹介し、優れた特殊な装置から得られる貴重な知見を参加者と共有することができた。また、企業ユーザーから2件の解析事例の報告が行われ、電子顕微鏡の解析技法について討議した。また、恒例行事である「ざっくばらんトーク」では参加者が失敗事例を持ち寄って解決法を討論しながら深夜までネットワーキングが行われた。

(5) 参加者：33名

(6) プログラム、

原子分解能STEMの基礎と応用	柴田 直哉（東京大学）
低中倍STEMの基礎とSTEM-EDS マッピング	鈴木 敏洋（トヨタテクノ）
STEM-EELSの基礎と応用	奥西 栄治（日本電子）
電流・電圧印加型 In-Situ TEM 観察	佐々木 勝寛（名古屋大学）
高温 In-situ 観察手法としてのFIB技術の開発	杉山 昌章（新日鐵）
Ar イオンビームによるFIBダメージ層除去の効果	佐々木 宏和（古河電工）
電子顕微鏡による断面・界面観察の新たな世界	清水 健一（慶應義塾大学）
トリプルビーム装置を用いたTEM試料作製	完山 正林（SIINT）
TEM-EELSによるNiSiの相同定技術	朝山 匡一郎（ルネサステクノロジ）
斜出射EDXによる表面付着物の元素分析	石本 竜二（トクヤマ）

文責 加藤直子（日本アイ・ピー・エム）